Pour publication immédiate : 14/04/2015 **GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO**

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE L'INSTALLATION DE LA PREMIERE TECHNOLOGIE DE PUCES INFORMATIQUES DU GENRE SUR LE CAMPUS DES NANOTECHNOLOGIES D'ALBANY DE SUNY POLYTECHNIC

SUNY Polytechnic et Nikon installeront le premier outil de lithographie en immersion de 450 mm du monde pour accélérer la production de puces informatiques de prochaine génération

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui que l'installation du premier scanner en immersion de 450 mm du monde a commencé au complexe de nanotechnologie d'Albany de l'Institut polytechnique de SUNY (SUNY Polytechnic Institute's Albany NanoTech Complex). Développé par Nikon Corporation, cet outil premier du genre accélèrera le développement de puces informatiques de prochaine génération utilisées dans une variété d'applications commerciales et de consommation.

« L'Etat de New York est fier d'abriter une des activités de recherche les plus sophistiquées de la planète en matière de puces informatiques, et avec des milliers de scientifiques et d'ingénieurs d'Albany à Buffalo, nous développons l'industrie comme jamais auparavant », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Ces investissements stratégiques dans les nanotechnologies, ainsi que le fait de transposer la réussite d'Albany dans l'ensemble du Nord de l'Etat, ont attiré des chefs de file mondiaux comme Nikon qui apportent un financement privé et des opportunités d'emploi dans l'Etat de New York. »

Une équipe comprenant plus de 50 ingénieurs des Etats-Unis et du monde entier sera impliquée dans cette installation. Le passage au 450 mm réalisé par SUNY Polytechnic représente un saut technologique important pour l'industrie des semi-conducteurs. Avec des applications allant des téléphones portables, tablettes, à la défense, l'énergie verte, et plus encore, le 450 mm permettra de produire plus du double du nombre de puces traitées sur les galettes de 300 mm actuelles, conduisant à une réduction des coûts et à des technologies de puces informatiques beaucoup plus rapides et plus fiables. Le scanner peut être visualisé ici.

L'Etat de New York est le premier à créer cette prochaine génération de technologies de puces informatiques, qui fait suite à l'annonce du Gouverneur Cuomo, selon laquelle

les partenaires du G450C, notamment Intel, IBM, GLOBALFOUNDRIES, TSMC et Samsung, investiraient plus de 4,8 milliards de dollars pour construire la première galette de 450 mm du monde et un environnement de développement d'équipements au complexe de nanotechnologies de SUNY Polytechnic.

Toshikazu Umatate, Vice President Sénior et Directeur Général de l'Unité d'affaires de lithographie pour semi-conducteurs, Nikon Corporation, a déclaré : « Le programme Nikon 450 mm progresse régulièrement et cette étape déterminante a été rendue possible grâce à une étroite collaboration avec nos nombreux partenaires de l'ensemble du consortium. Nikon s'est engagé à l'égard de l'innovation et des progrès continus en matière de lithographie, et soutenir l'industrie pour la réalisation de la prochaine génération de fabrication de semi-conducteurs. »

Dr. Alain E. Kaloyeros, Président Directeur Général, SUNY Polytechnic Institute, a déclaré : « La livraison du scanner en immersion Nikon est une victoire pour l'innovation pour l'Etat de New York et un autre jalon important de la feuille de route technologique du Gouverneur Cuomo conduisant l'industrie mondiale des semi-conducteurs au développement de puces informatiques de prochaine génération. L'Etat de New York reste à la fine pointe de l'innovation, en tirant parti de l'expertise et des ressources des partenaires de classe mondiale comme Nikon pour la définition de l'avenir des technologies de puces informatiques tout en stimulant le développement informatique et la création d'emplois. »

En juillet 2013, le Gouverneur Cuomo a annoncé un partenariat de 350 millions de dollars entre la Faculté des sciences et d'ingénierie à l'échelle nanométrique de SUNY Polytechnic et Nikon pour développer la technologie de photolithographie de 450 mm de prochaine génération. La photolithographie est devenue une importante étape dans la fabrication des transistors à l'échelle du nanomètre, qui sont les éléments fondamentaux des puces informatiques d'aujourd'hui. Nikon et SUNY Polytechnic ont travaillé sans relâche pour mettre en ligne le scanner de lithographie en immersion en moins de 12 mois et dévoilé les premières galettes de 450 mm intégralement structurées du monde en juillet 2014. L'outil en immersion de Nikon rejoint désormais l'infrastructure existante de 450 mm de la Faculté des sciences et d'ingénierie à l'échelle nanométrique de SUNY Polytechnic, portant l'investissement total des équipements de galettes de 450 mm du complexe de nanotechnologie d'Albany à plus de 700 millions de dollars.

A propos de Nikon

Depuis 1980, Nikon Corporation a révolutionné la lithographie avec des produits et technologies innovants. La société est un leader mondial des systèmes de lithographie pour semi-conducteurs dans l'industrie de la fabrication microélectronique avec plus de 8 000 systèmes de lithographie (semi-conducteurs) installés dans le monde. Nikon offre un vaste choix de systèmes de lithographie de classe de production destinés aux industries des semi-conducteurs, de l'affichage à écran plat (FPD), et des têtes magnétiques à film mince (TFH). Nikon Precision Inc. offre le service, la formation, les

applications et le support technique, ainsi que les ventes et le marketing pour les systèmes de lithographie de Nikon en Amérique du Nord. Pour plus d'informations sur Nikon, visiter http://www.nikon.com.

###

Des informations complémentaires sont disponibles à www.governor.ny.gov
État de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418